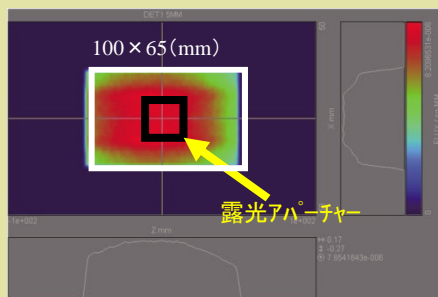


193nmエキシマランプ搭載解析露光装置

193nmエキシマランプ（ウシオ電機社製）を搭載した
オープンフレーム露光システムです。

特徴

- ◆ 193nmエキシマランプを搭載したレジスト評価用オープンフレーム露光装置
- ◆ 露光量を変えながら、ウエハ上に最大100ショットのOF露光が可能
- ◆ ArFレジストの感度、コントラストの評価、シミュレーションパラメータの測定が可能
- ◆ 従来のエキシマレーザー光源と違い、ガス供給系は不要
- ◆ オプションとして、液浸露光ステージ、アウトガス捕集機能、液浸リーチング物質評価ツールが搭載可能



《上: 193nmランプ 下: 照度マップ》



仕様

- 露光波長 193nm (FWHM=3nm)
- 露光スポット10mm□または5mm□ (面内均一性 ±5%)
- 最大露光ショット数 25ショットまたは、100ショット(6インチウエハ時)
- 適用ウエハサイズ 4,5,6,8インチSi
- ステージ: X-Yステージ搭載
- 照度 1mW/cm² on Wafer (ランプ寿命 70hr)

リソテックジャパンでは、常時ご評価頂くためのデモ装置を準備しております。ご来訪の上、ご評価頂くか、サンプルを送付して頂ければ、各装置評価用のデータ取得を行いますので、お気軽にお申し付けください。また、特殊な仕様についても検討いたしますのでご相談ください。

【装置開発製造元】

LTJ リソテックジャパン株式会社
Litho Tech Japan

〒332-0034 埼玉県川口市並木2-6-6-201
TEL 048-258-6775 FAX 048-258-6673
E-mail: tech-support@ltj.co.jp

【販売会社】